

公司代码：688012

公司简称：中微公司



**中微半导体设备（上海）股份有限公司  
2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

## 2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度不分配利润，资本公积不转增。

## 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中微公司	688012	不适用

#### 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	刘晓宇	胡潇
办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
电话	021-61001199	021-61001199
电子信箱	IR@amecnsh.com	IR@amecnsh.com

## 2 报告期公司主要业务简介



### （一）主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售。公司瞄准世界科技前沿，基于在半导体设备制造产业多年积累的专业技术，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED 生产、MEMS 制造以及其他微观工艺的高端设备领域。

公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。公司的 MOCVD 设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。

公司主要为集成电路、LED 芯片、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设备，其中主要产品的具体情况如下：

### 1、刻蚀设备

产品类别	图示	应用领域
电容性等离子体刻蚀设备		主要应用于集成电路制造中氧化硅、氮化硅及低介电系数膜层等电介质材料的刻蚀
电感性等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备		主要应用于在集成电路制造中单晶硅、多晶硅以及多种介质等材料的刻蚀
		主要应用于 CMOS 图像传感器、MEMS 芯片、2.5D 芯片、3D 芯片和芯片切割等通孔及沟槽的刻蚀

### 2、MOCVD 设备

产品类别	图示	应用领域
MOCVD 设备		蓝绿光及紫外 LED 外延片和功率器件的生产

### 3、其他设备

产品类别	图示	应用领域
VOC 设备		平板显示生产线等工业用的空气净化

## **(二) 主要经营模式**

### **1、盈利模式**

公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路、LED 芯片、先进封装、MEMS 等半导体产品的制造公司销售刻蚀设备和 MOCVD 设备、提供配件或服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售，其他收入来源于设备相关配件销售及设备维护服务等。

### **2、研发模式**

公司主要采取自主研发的模式。根据公司产品成熟度，公司的研发流程主要包括概念与可行性阶段、Alpha 阶段、Beta 阶段、量产阶段。

公司按照刻蚀设备、MOCVD 设备等不同研发对象和项目产品，组成了相对独立的研发团队。不同产品研发团队拥有各自独立的机械设计、工艺开发、产品管理和技术支持团队，而在电气工程、平台工程、软件工程等方面则采用共享的方式进行研发支持。通过这种矩阵管理的方法，实现了人才、营运等资源在不同的产品及技术服务之间灵活分配，实现共享经验知识，优化资源使用效率，使公司能够快速响应不断变化的研发要求，进行持续的技术创新。

### **3、采购模式**

为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。达到经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等众多标准要求的供应商，才可以被考虑纳入公司合格供应商名录，并定期审核。目前，公司已经与全球众多供应商建立了长期、稳定的合作关系。

### **4、生产模式**

公司主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产为主，结合少量库存式生产为辅的生产方式。订单式生产是指公司在与客户签订订单后，根据订单情况进行定制化设计及生产制造，以应对客户的差异化需求。库存式生产是指公司对设备通用组件或成批量出货设备常用组件根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。

### **5、营销及销售模式**

公司采取直销为主的销售模式，因欧洲市场的客户较为分散，公司在该区域通过代理商模式进行销售。公司设有全球业务部负责公司所有产品的销售管理，下设中国大陆、中国台湾、韩国、日本、新加坡、美国等国家或者地区的区域销售部门。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

半导体设备行业是一个全球化程度较高的行业，受国际经济波动、半导体市场、终端消费市场的需求影响，其发展往往呈现一定的周期性波动。当宏观经济和终端消费市场需求变化较大时，半导体生产厂商会调整其资本性支出规模和对半导体设备的采购计划，从而对公司的营业收入和盈利产生影响。

全球集成电路和以 LED 为代表的光电子器件的销售总额合计占有所有半导体产品销售总额的 90% 以上，是半导体产品最重要的组成部分。受终端芯片价格下降及生产产能持续释放等因素影响，2019 年度半导体设备市场和 LED 设备市场均呈现下滑态势。SEMI 数据显示，2019 年度半导体设备市场下滑幅度约为 9%；LED 设备市场也持续低迷。公司所处的细分行业为半导体设备行业中的刻蚀设备行业和 LED 设备行业中的 MOCVD 设备行业。

#### 1、刻蚀设备

集成电路设备包括晶圆制造设备、封装设备和测试设备等，晶圆制造设备的市场规模占比超过集成电路设备整体市场规模的 80%。

晶圆制造设备从类别上讲可以分为刻蚀、光刻、薄膜沉积、检测、涂胶显影等十多类，其合计投资总额通常占整个晶圆厂投资总额的 75% 左右，其中刻蚀设备、光刻设备、薄膜沉积设备是集成电路前道生产工艺中最重要的三类设备。根据 VLSI Research 统计，2019 年按全球晶圆制造设备销售金额占比类推，目前刻蚀设备（包含清洗设备）、光刻机和薄膜沉积设备分别占晶圆制造设备价值量约 24%、23% 和 22%。

随着集成电路芯片制造工艺的进步，线宽不断缩小、芯片结构 3D 化，晶圆制造向 7 纳米、5 纳米以及更先进的工艺发展。由于目前先进工艺芯片加工使用的浸没式光刻机受到波长限制，14 纳米及以下的逻辑器件微观结构的加工多通过等离子体刻蚀和薄膜沉积的工艺组合——多重模板工艺来实现，使得相关设备的加工步骤增多。

#### 2、MOCVD 设备

LED 产业链由衬底加工、LED 外延片生产、芯片制造和器件封装组成。该产业链中主要涉及的设备包括：衬底加工需要的单晶炉、多线切割机；制造外延片需要的 MOCVD 设备；制造芯片需要的光刻、刻蚀、清洗、检测设备；封装需要的贴片机、固晶机、焊线台和灌胶机等。

LED 外延片的制备是 LED 芯片生产的重要步骤，与集成电路在多种核心设备间循环的制造工艺不同，LED 外延片主要通过 MOCVD 单种设备实现。MOCVD 设备采购金额一般占 LED 生产线总投入的一半以上，是 LED 外延片制造中最重要的设备。

目前 MOCVD 设备主要用于氮化镓基及砷化镓基半导体材料外延生长，其中氮化镓基 LED MOCVD 主要用于生产氮化镓基 LED 的外延片。

除用于制造通用照明和背光显示的蓝光 LED，MOCVD 设备还可制造应用于高端显示的 Mini LED 和 Micro LED、用于杀菌消毒和空气净化的紫外 LED、应用于电力电子的功率器件，随着这些新兴领域的应用拓展及逐步推广，氮化镓基 MOCVD 设备的市场规模有望进一步扩大。

根据 Yole Développement 预测，2019 年氮化镓基 LED 芯片扩产开始减缓，LED 芯片制造厂陆续专注于 Mini LED 的研发和小批量生产，2020 年其将成为 LED 芯片制造厂主流的扩产方向。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前半导体设备市场主要由欧美、日本等国家的企业所占据。近年来我国半导体设备行业整体水平不断提高。公司作为国内半导体设备代表公司之一，持续保持高研发投入，在产品性价比、售后服务、地缘等方面的优势逐渐显现。

在刻蚀设备方面，全球刻蚀设备市场呈现垄断格局，泛林半导体、东京电子、应用材料占据主要市场份额；公司设备已应用于全球先进的 7 纳米和 5 纳米集成电路加工制造生产线，但在销售规模上与全球巨头尚有差距。

在 MOCVD 设备领域，公司 MOCVD 设备持续在行业领先客户生产线上大规模投入量产，保持在行业内的领先地位。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

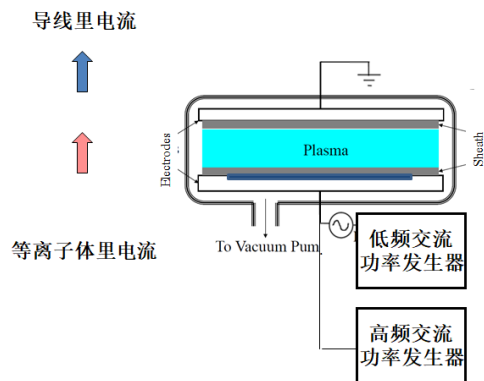
### 1、等离子体刻蚀技术

刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀，湿法刻蚀各向异性较差，侧壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差，通常用于工艺尺寸较大的应用，或用于干法刻蚀后清洗残留物等。干法刻蚀是目前主流的刻蚀技术，其中以等离子体干法刻蚀为主导。

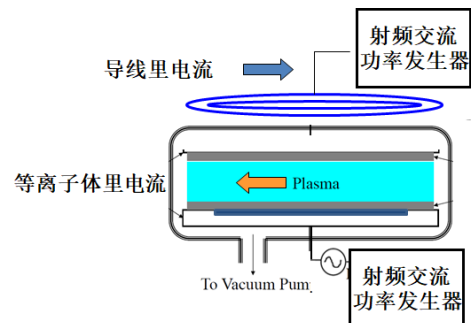
等离子体刻蚀设备是一种大型真空的全自动的加工设备，一般由多个真空等离子体反应腔和主机传递系统构成。等离子体刻蚀设备的分类与刻蚀工艺密切相关，其原理是利用等离子体放电产生的带化学活性的粒子，在离子的轰击下，与表面的材料发生化学反应，产生可挥发的气体，从而在表面的材料上加工出微观结构。根据产生等离子体方法的不同，干法刻蚀主要分为电容性等离子体刻蚀和电感性等离子体刻蚀；根据被刻蚀材料类型的不同，干法刻蚀主要是刻蚀介质材料、硅材料和金属材料。电容性等离子体刻蚀主要是以高能离子在较硬的介质材料上，刻蚀高深宽比的深孔、沟槽等微观结构；而电感性等离子体刻蚀主要是以较低的离子能量和极均匀的离子

浓度刻蚀较软的或较薄的材料。这两种刻蚀设备涵盖了主要的刻蚀应用。

### 电容性等离子体刻蚀反应腔



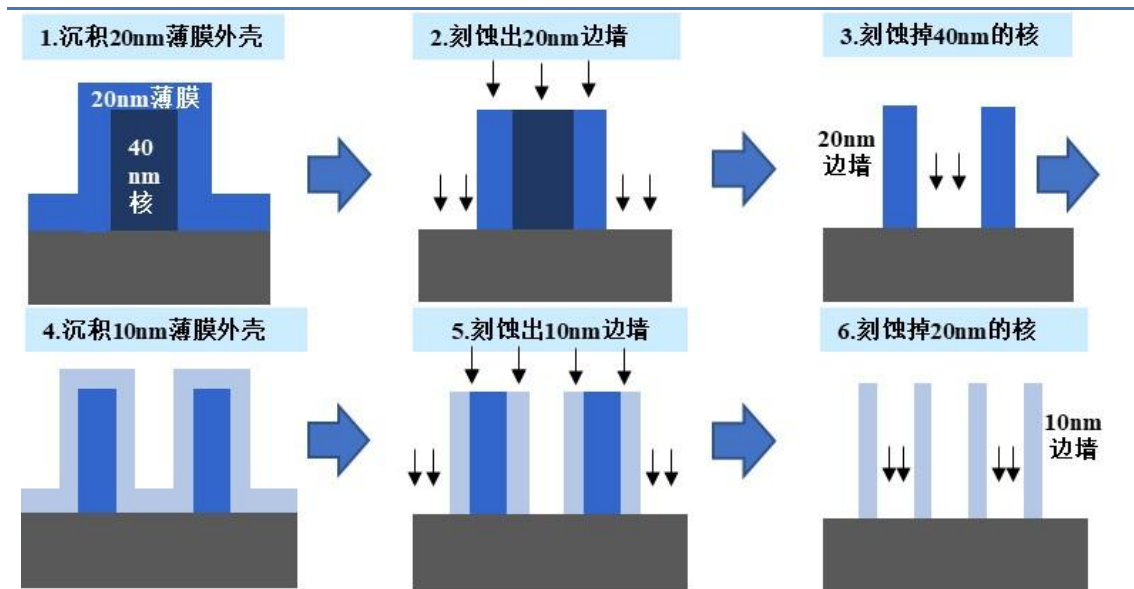
### 电感性等离子体刻蚀反应腔



## 2、刻蚀技术水平发展状况及未来发展趋势

随着国际上先进芯片从 14 纳米到 10 纳米阶段向 7 纳米、5 纳米甚至更先进工艺的方向发展，当前沉浸式光刻机受光波长的限制，需要结合刻蚀和薄膜设备，采用多重模板工艺，利用刻蚀工艺实现更小的尺寸，使得刻蚀技术及相关设备的重要性进一步提升。下图展示 10 纳米多重模板工艺原理，涉及多次刻蚀：

### 10 纳米多重模板工艺原理，涉及多次刻蚀



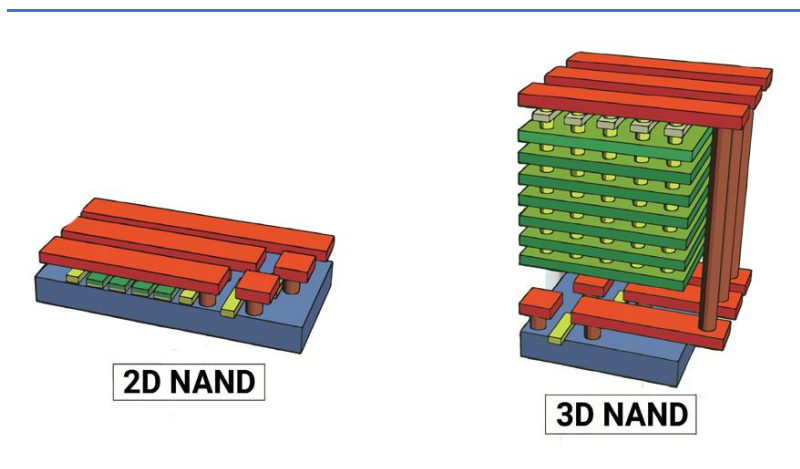
芯片线宽的缩小及多重模板工艺等新制造工艺的采用，对刻蚀技术的精确度和重复性要求更高。刻蚀技术需要在刻蚀速率、各向异性、刻蚀偏差、选择比、深宽比、均匀性、残留物、等离子体引起的敏感器件损伤、颗粒沾污等指标上满足更高的要求，刻蚀设备随之更新进步，例如：



刻蚀设备的静电吸盘从原来的 4 个分区扩展到超过 20 个分区，以实现更高要求的均匀性；更好的腔体温度控制提高生产重复性。

集成电路 2D 存储器件的线宽已接近物理极限，NAND 闪存已进入 3D 时代。目前 64 层 3D NAND 闪存已进入大生产，96 层和 128 层闪存已处于小批量生产阶段。3D NAND 制造过程中，增加集成度的主要方法不再是缩小单层上线宽而是增加堆叠的层数。刻蚀要在氧化硅和氮化硅的叠层结构上，加工 40: 1 到 60: 1 的极深孔或极深的沟槽。3D NAND 层数的增加要求刻蚀技术实现更高的深宽比。

2D NAND 及 3D NAND 示意图



### 3、MOCVD 设备行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

在 LED 领域存在一个类似摩尔定律的海兹定律，即 LED 的价格每 10 年将为原来的 1/10，输出流明则增加 20 倍。自 1993 年第一颗商业化蓝光 LED 诞生以来，经过 20 多年的发展，制造蓝光 LED 的 MOCVD 技术已达到较为成熟的阶段，目前 MOCVD 设备企业主要在提高大规模外延生产所需的性能、降低生产成本、具备大尺寸衬底外延能力等方面进行技术开发，以满足下游应用市场的需求。

MOCVD 设备还可制造应用于高端显示用 Mini LED 和 Micro LED、消毒和促进植物生长用的紫外 LED、用于电力电子领域的功率器件等。

### 4、所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

半导体设备产业经过了数十年的发展，如今已形成了相对固定的寡头竞争格局，和相对稳定的业态和模式。半导体在技术上的不断突破所带来的应用迭代，改变了许多传统行业亦催生众多应用，如互联网、智能手机、人工智能、5G 等新兴产业。半导体的制造离不开半导体设备，半

导体设备行业的持续发展间接地促进了各类新产业的诞生。

集成电路应用领域中，以物联网为代表的新兴产业，在可预见的未来内发展趋势明朗。可穿戴设备、智能家电、自动驾驶汽车、智能机器人、3D 显示等应用的发展将释放出大量芯片制造的需求，进一步推动上游半导体设备行业的稳步增长。

光电子 LED 产业中，以 LED 新型显示为代表的新兴产业，逐渐成为显示行业追逐的热点。当前新兴的小间距 LED 显示在物理拼缝、显示效果、功耗、使用寿命方面均有优越表现，未来随着 Mini LED 和 Micro LED 技术的进一步发展和完善，LED 新型显示产业有望成为继 LED 照明产业后 MOCVD 应用产业发展最迅速的版块之一。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	4,774,054,304.04	3,532,678,998.55	35.14%	2,276,021,401.76
营业收入	1,946,949,250.75	1,639,288,330.40	18.77%	971,920,551.65
归属于上市公司股东的净利润	188,564,219.09	90,869,243.54	107.51%	29,918,655.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,539,304.73	104,283,115.16	41.48%	-69,437,227.39
归属于上市公司股东的净资产	3,751,076,960.24	2,116,405,814.74	77.24%	266,211,540.56
经营活动产生的现金流量净额	133,270,991.54	261,107,142.05	-48.96%	-150,087,012.82
基本每股收益(元/股)	0.37	0.20	85.00%	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.20	85.00%	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.71%	7.48%	减少0.77个百分点	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	21.81%	24.65%	减少2.84个百分点	34.00%

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	376,288,946.91	424,773,385.77	416,459,279.16	729,427,638.91
归属于上市公司股东的净利润	13,840,957.35	16,530,166.90	104,544,659.28	53,648,435.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,129,953.32	13,955,156.21	97,324,680.83	28,129,514.37
经营活动产生的现金流量净额	-228,786,493.43	-145,744,166.47	220,255,874.32	287,545,777.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		18,497						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		21,381						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
上海创业投资有限公司		96,383,533	18.02	96,383,533		无		国有法人
巽鑫（上海）投资有限 公司		93,337,887	17.45	93,337,887		无		国有法人
中微半导体设备（上海） 股份有限公司未确认持 有人证券专用账户		76,265,514	14.26	76,265,514		无		其他
南昌智微企业管理合伙 企业（有限合伙）		30,644,454	5.73	30,644,454		无		境内非国 有法人
置都（上海）投资中心 （有限合伙）		26,383,986	4.93	26,383,986		无		境内非国 有法人

嘉兴悦橙投资合伙企业 (有限合伙)		22,565,991	4.22	22,565,991		无	境内非国 有法人
国开创新资本投资有限 责任公司		19,691,183	3.68	19,691,183		无	国有法人
嘉兴创橙投资合伙企业 (有限合伙)		13,184,004	2.46	13,184,004		无	境内非国 有法人
义乌和谐锦弘股权投资 合伙企业(有限合伙)		12,796,240	2.39	12,796,240		无	境内非国 有法人
上海自贸区股权投资基 金管理有限公司-上海 自贸试验区智芯投资中 心(有限合伙)		11,834,830	2.21	11,834,830		无	境内非国 有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联 关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

#### 存托凭证持有人情况

适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 19.47 亿元，同比增长 18.77%，实现归属于上市公司股东净利润 1.89 亿元，同比增长 107.51%。

#### 2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见 2019 年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

#### 4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用